

Samsung установит первый прорывной High-NA EUV инструмент
к концу 2024 года

Этот передовой инструмент будет использоваться для исследований и разработки технологических процессов следующего поколения. Ожидается, что система Samsung High-NA EUV будет введена в эксплуатацию к середине 2025 года, что позволит компании опередить конкурентов TSMC и SK hynix. Эта технология имеет решающее значение для развития производства чипов с разрешением 8 нм, что значительно превосходит текущие системы Low-NA EUV, которые достигают 13 нм.

Samsung также развивает комплексную экосистему вокруг этой технологии, сотрудничая с Lasertec для проверки масок, JSR для фоторезистов, Tokyo Electron для машин травления и Synopsys для инструментов проектирования.

Цена систем High-NA EUV составляет от 380 до 400 миллионов долларов..